

# DIN 50453-2:2023-08 (D)

## Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen - Teil 2: Siliciumdioxid-Schichten, Optisches Verfahren

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens .....	4
5 Geräte .....	4
6 Silicium-Substrat .....	5
7 Zusammensetzung der Ätzmischungen .....	5
8 Einflüsse auf das Messergebnis .....	5
8.1 Struktur der Siliciumdioxid-Schicht.....	5
8.2 Temperatur .....	5
8.3 Dotierung .....	5
9 Probenvorbereitung.....	5
10 Durchführung .....	5
11 Auswertung .....	7
12 Präzision des Verfahrens .....	7
13 Prüfbericht .....	8
Literaturhinweise .....	9
<b>Bilder</b>	
Bild 1 — Prüfaufbau zur Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen .....	6